

Томский государственный университет
Систем управления и радиоэлектроники
Председателю диссертационного совета Д212.268.04
на базе Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники,
д.т.н., профессору Шандарову С.М.

634050, г. Томск, пр. Ленина 40

Уважаемый Станислав Михайлович!

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом по диссертационной работе Федина Ивана Владимировича «Мощные быстродействующие диоды на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия» по специальности 01.04.04 – физическая электроника, на соискание учёной степени кандидата технических наук. Сведения, необходимые для размещения на сайте ТУСУР, прилагаются.

Доктор технических наук,
профессор кафедры Полупроводниковых приборов
и микроэлектроники Новосибирского
государственного технического университета


А.А. Величко

Приложение: Сведения об официальном оппоненте на 2 стр. в 1 экз.

Подпись Величко А.А. удостоверяю,
Учёный секретарь НГТУ

Г.М. Шумский



Сведения об официальном оппоненте

по диссертационной работе Федина Ивана Владимировича «Мощные быстродействующие диоды на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия» по специальности 01.04.04 – физическая электроника, на соискание учёной степени кандидата технических наук.

Фамилия, имя, отчество	Величко Александр Андреевич
Учёная степень (с указанием шифра и наименования научной специальности, по которой защищена диссертация)	доктор технических наук, специальность 01.04.10 «Физика полупроводников»
Учёное звание (по кафедре, специальности)	Профессор
Основное место работы	
Должность	Профессор
Наименование подразделения (кафедра, лаборатория)	Кафедра Полупроводниковых приборов и микроэлектроники
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ)
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, телефон, адрес электронной почты организации	Россия, 630073, г. Новосибирск, пр-т К.Маркса, 20, www.nstu.ru Тел. (383) 346-50-01, rector@NSTU.RU
Публикации по специальности 01.04.04 – физическая электроника (4-5 за последние 5 лет, в том числе обязательно указание публикаций за последние 3 года)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ температурной нестабильности гетероструктуры InAs/GaAs в процессе молекулярно лучевой эпитаксии / А. В. Кацюба, А. А. Величко, В. А. Илюшин, Г. Ф. Сивых // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - 2014. – № 7. – С. 70–73. 2. Topyakova M. V. The ion beam etching the materials for micro- and nano-technologies / M. V. Topyakova, A. A. Velichko // The 15 international conference of young specialists on micro/nanotechnologies and electron devices (EDM 2014) : proc., Altai, Erlagol, 30 June – 4 July 2014. – Novosibirsk : IEEE, 2014. – P. 27-29. 3. Исследование осцилляций интенсивности зеркального рефлекса дифракции быстрых электронов в процессе гетероэпитаксии CaF₂ на Si(111) / А. А. Величко, В. А. Илюшин, А. Ю. Крупин, В. А. Гавриленко, Н. И. Филимонова, С. С. Кудаев // Актуальные проблемы электронного приборостроения = Actual problems of electronic instrument engi- 	

- neering : тр. 12 междунар. конф. АПЭП-2014, Новосибирск, 2–4 окт. 2014 г. : в 7 т. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. – Т. 2. – С. 24-28.
4. Анализ интенсивности осцилляций зеркального рефлекса ДБЭ в процессе получения структур CaF₂/Si/CaF₂ методом молекулярно-лучевой эпитаксии / А. А. Величко, В. А. Илюшин, А. Ю. Крупин, В. А. Гавриленко, Н. И. Филимонова // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - 2016. – № 9. – С. 33–37.
 5. Особенности морфологии поверхности пленок CaF₂/Si(100), полученных методом твердофазной эпитаксии / В. А. Илюшин, А. А. Величко, А. Ю. Крупин, В. А. Гавриленко, А. Н. Савинов, А. В. Кацюба // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - 2016. – № 11. – С. 95–99.
 6. Filimonova N. I. Molecular beam epitaxy of BaF₂/CaF₂ buffer layers on the Si(100) substrate for monolithic photoreceivers / N. I. Filimonova, A. A. Velichko, V. A. Ilyushin // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. - 2017. - Vol. 53, № 3 - P. 303-310.
 7. Филимонова Н. И. Молекулярно-лучевая эпитаксия буферных слоев BaF₂/CaF₂ на подложке Si(100) для монолитных фотоприёмных устройств / Н. И. Филимонова, В. А. Илюшин, А. А. Величко // Автометрия. - 2017. – Т. 53, № 3. – С. 117–124.
 8. Величко А. А. Технология получения квантовых точек кремния в матрице CaF₂ / А. А. Величко, В. А. Илюшин, А. Ю. Крупин // Наука. Технологии. Инновации : сб. научн. тр. : в 9 ч., Новосибирск, 3–7 дек. 2018 г. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. – Ч. 6. – С. 20–24.
 9. Фотолюминесценция нанокристаллического Si, встроенного в диэлектрическую матрицу CaF₂ = Photoluminescence of the Nanocrystal Si Embedded in the Dielectric CaF₂ Matrix / А. А. Величко, В. А. Илюшин, Н. И. Филимонова, А. Ю. Крупин // Актуальные проблемы электронного приборостроения (АПЭП–2018) = Actual problems of electronic instrument engineering (APEIE–2018) : тр. 14 междунар. науч.-техн. конф., Новосибирск, 2–6 окт. 2018 г. : в 8 т. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. – Т. 2. – С. 32–34.
 10. Тензорезисторы на структурах "кремний на сапфире" (КНС) и Si/CaF₂/Si = Tenzoresistors based on silicon and Si/CaF₂/Si on sapphire structures / А. А. Величко, В. А. Илюшин, Н. И. Филимонова, А. Ю. Крупин, А. В. Кацюба // Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. - 2018. – № 2 (39). – С. 30–39.

Д.т.н., профессор

Учёный секретарь НГТУ

А.А. Величко

Г.М. Шумский

